

開示の要約

基板洗浄装置および基板処理装置

- 5 基板表面上に形成された微小な凹部内に存在するパーティクルを除去することができる基板洗浄装置が開示される。基板洗浄装置は、基板を保持する基板保持部と、基板の表面に二流体噴流を供給する二流体ノズルとを備える。二流体ノズルは、第1の二流体噴流を噴射する第1の噴射ノズルと、前記第1の二流体噴流よりも高速の第2の二流体噴流を噴射する第2の噴射ノズルとを備え、前記第2
- 10 の噴射ノズルは、前記第1の噴射ノズルを囲むように配置されている。

図5